(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

庁内整理番号

(11)特許出顧公開番号

特開平8-171020

(43)公開日 平成8年(1996)7月2日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

技術表示箇所

G02B 6/00

6/122

6/42

301

G 0 2 B 6/12

H01L 31/02

С

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 6 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号

特願平6-314786

(71)出顧人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号

(22)出顧日 平成6年(1994)12月19日

(72)発明者 三冨 修

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 柴田 泰夫

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

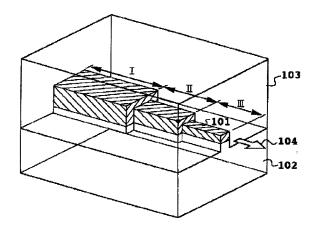
(74)代理人 弁理士 谷 義一 (外1名)

(54) 【発明の名称】 光結合デバイス

(57)【要約】

【目的】 異なる2つの光機能素子、特に複数のデバイ スを集積化した光機能素子間を低損失で光結合をとり、 しかも製作の容易な光結合デバイスを提供する。

【構成】 スポットサイズ変換部の光導波路コア部の寸 法をステップ状に変化させて構成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 互いに異なった構造で光波のスポットサ イズが異なる光機能デバイスを相互に低損失で光結合す る光結合デバイスであって、

前記光機能デバイスの一方から光波を他方の光機能デバ イスへ伝送する少なくとも一本の光導波路を有し、該光 導波路のコアが少なくとも幅もしくは厚さの一方がステ ップ状に径寸法が変化していることを特徴とする光結合 デバイス。

クに形成されていることを特徴とする請求項1に記載の 光結合デバイス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光導波路を伝わる光波 のスポット径を低損失で変換する光結合デバイスの構成 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体レーザダイオードや半導体光スイ ッチ等の半導体光導波路デバイス(一方の光機能デバイ 20 ス)と、単一モード光ファイバ(他方の光機能デバイ ス) との間を光結合させる場合、光導波路デバイスの端 面と光ファイバとを直接に突合せ結合(バットジョイン ト) させると、互いの光導波路光波のスポットサイズが 異なっているために、直接突合せ部の結合損失が問題に なる。通常、半導体光導波路デバイスの光波スポットサ イズ (モード半径:W) は 1μ m程度であり、これに対 して光ファイバのスポットサイズは約5μmであるの で、この場合の結合損失は約10dBになる。そこで、 従来は、レンズによってスポットサイズを変換すること 30 によって、光半導体デバイスと光ファイバとの結合損失 を低減化する方法が、一般にとられている。

【0003】複数のレーザダイオードを形成した光機能 素子とアレー光ファイバとの間を、1個のレンズで光結 合させる場合について、従来の光結合デバイスの構成例 を図9に示す。図9において、符号500は光機能素 子、502,503は半導体基板、501はレーザダイ オードの活性領域(光導波路コア部)、504は光波、 509はレンズ、510は光ファイバ、511は複数 (図では4本)の光ファイバ510を一定間隔で固定す るためのVーグルーブアレーである。このような構成に おいては、光機能素子500の集積規模が大きくなるに 従って、レンズ509の収差等の影響により、結合損失 が大きくなるために、1個の半導体基板に集積できる光 機能素子部の個数に制限があった。

【0004】図10に示すような、テーパ状の光導波路 により光のスポットサイズを変換する光結合デバイス を、レンズの代わりとして用いることにより、レーザダ イオードと光ファイバとの間を低損失に光結合させる方 法がある。図10は、従来の光結合デバイスの上面図で 50 イスは、互いに異なった構造で光波のスポットサイズが

あり、図11は同光結合デバイスの側断面図であり、図 12は同光結合デバイスの動作原理を説明するための特 性図である。図に示すように、光導波路を形成するコア 601は上から見るとテーパ状に入力側から出力側に縮 径しており、側面から見ると上面部が下方に傾斜して出 力側に向かって縮径している。この時のコア601の入 力側の幅寸法をw.、厚さ寸法をt.で示し、同コア6 01の出力側の幅寸法をw。、厚さ寸法をt。で示す。 なお、602、603はクラッド層であり、612は入 【請求項2】 前記光機能デバイスの一方とモノリシッ 10 力光、604は出力光である。このような構成の光結合 デバイスにおいては、スポットサイズWとコアの大きさ (t、w) との関係を示した図12から分かるように、 光導波路のコア601の比屈折率差Δn [= (n-n) / n:、ここで、n:およびnはそれぞれクラッド 602,603、およびコア601の屈折率である]を 一定の大きさに固定した場合、コア601の厚さt、も しくは幅wをOから次第に大きくしていくと、導波光 (基本モード光) のスポットサイズWは、無限の大きさ から次第に小さくなり、極小値をとった後、再び大きく なる関係がある。ここで、t、wが大きくなり過ぎる と、多モード光導波路になり、高次モード変換による損 失が大きくなるために、通常、この領域の寸法は用いら れない。この関係を利用して、光結合デバイスのコア6 01の大きさtおよびwの設計においては、光入射端側 (レーザダイオードとの結合側)では、レーザダイオー ド光612のスポットサイズ(約1 µm)と同程度のス ポットサイズW: を与える寸法w: , t: (=数100 nm~数μm)に、光出射端側では、光ファイバのスポ ットサイズ(約5μm)と同程度の大きさW₆を与える 寸法 t 。, w。 (=数10 n m~数 μ m) に設定すれば よい。また、コア601の大きさがテーパ状になってい る領域の長さLは、放射による損失を低減するために、 数 10μ mから数mm以上の長さに設定される。しか し、このようなテーパ状導波路を形成するには、例え ば、選択成長技術あるいは複雑かつ高精度なプロセス技 術を要し、製作上に困難性があった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記事情に 鑑みてなされたもので、その課題は、異なる2つの光機 40 能素子、特に複数のデバイスを集積化した光機能素子間 を低損失で光結合をとり、しかも製作の容易な光結合デ バイスを提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明では、スポットサ イズ変換部の光導波路コア部の寸法をステップ状に変化 させて構成することにより、低損失な結合特性を得ると ともに製作性を改良した光結合デバイスを実現可能とし ている。

【0007】すなわち、本発明の請求項1の光結合デバ

異なる光機能デバイスを相互に低損失で光結合する光結 合デバイスであって、前記光機能デバイスの一方から光 波を他方の光機能デバイスへ伝送する少なくとも一本の 光導波路を有し、該光導波路のコアが少なくとも幅もし くは厚さの一方がステップ状に径寸法が変化しているこ とを特徴とする。

【0008】また、本発明の請求項2の光結合デバイス は、前記請求項1の光結合デバイスにおいて、光機能デ バイスの一方とモノリシックに形成されていることを特 徴とする。

[0009]

【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例と原理 を詳細に説明する。

【0010】(実施例1)図1ないし図3は、本発明に よる光結合デバイスの第1の実施例を示すものであり、 スポットサイズ変換を2段階で縮径した構造の光導波路 で行う場合の本発明の光結合デバイスの基本構成を示し ている。図1は本光結合デバイスの斜視図、図2は本光 結合デバイスの側断面図、図3は同光結合デバイスの上 面図である。図中、符号101は光導波路のコア、10 20 2は n 形半導体基板、103は埋め込み層あるいは p 形 半導体層であり、これらn形半導体基板102およびp 形半導体層103は光導波路のクラッド領域になる。図 中の領域 [は半導体レーザや光変調器あるいは光スイッ チ等の光機能素子部である。また、領域[[および]][は、スポットサイズ変換機能を有する光導波路であり、 領域Iの光導波路の光波スポットサイズを段階的に徐々 に変化させ、光出射端部に接続される光機能デバイス (例えば光ファイバ) との結合損失が小さくなるように している。104は出射光である。

【0011】ここで、領域IIおよびIIIのコアの幅と厚 さは、図2、図3に示すように、それぞれ、wz, t 2, W3, t3 である。これらの領域IIおよびIII にお ける光スポットサイズは、幅wi、厚さtiの領域Iの 光導波路のスポットサイズと、結合しようとする光ファ イバのスポットサイズとの中間の大きさになるように、 設定される。また、領域II, III の導波路長L2, L3 は、それぞれの領域における伝搬光がそれぞれの定常導 波モードに近い状態になるのに必要な長さに設定すれば 発明の効果が得られる。

【0012】(実施例2)図4および図5は、本発明に よる光結合デバイスの第2の実施例である。図4は同デ バイスの側断面図、図5は同デバイスの上面図である。 図中、符号202はn形InP基板、203はiもしく はp形InP層であり、205, 206, 207はIn GaAsP等で構成される光導波路のコアである。ま た、208は段階的に縮径しているコアの厚さ t2.t 。を選択エッチング法にて形成する時に使用された I n Pストップ層である。ここでは、領域III の光導波路

と、結合しようとする光ファイバとの間の結合損失が最 小になるように、領域III の光導波路の寸法wa, ta が設定され、さらに領域 [と領域] [との結合損失が最小 になるように、領域IIの光導波路の寸法wz, tz が設 定される。なお、光導波路製作プロセスを容易にするた めに、コア205, 206, 207の幅は、全領域で同 一の大きさw ($=w_1 = w_2 = w_3$) にしてある。この 点が本実施例の特徴の一つである。

【0013】図6、図7は、前記第2の実施例におい て、本発明の効果を説明するための図であり、領域Ⅱお よびIIIの光導波路の最適なコアの厚さ t 2 および t 3 と、光ファイバ結合損失との関係を示したグラフであ る。これらのコアの厚さ t2 および t3 は、有限要素法 を用いたスカラー波近似解析による計算値である。ここ では、波長 $\lambda = 1$. 55 μ m用で、スポット半径Wf = 4 μ mの光ファイバに結合させ、コア205, 206, 207として、1. 3μm組成のInGaAsPを用い た場合を示している。また、領域Iの光機能素子部のコ ア寸法は $w_1 = 1.5 \mu m$ 、 $t_1 = 0.3 \mu m$ とした。 図6は、領域III の光導波路のコアの最適寸法t3,w ₃ を設計するための計算結果である。この結果より、w $3 = 1.5 \mu \text{ m と し た 時 、 最適コア厚 } t_3 は 、 t_3 = 7$ 00~800Å程度にすればよく、その時の光ファイバ との結合損失は約1dBの特性になる。図7は、w= 1. 5μ m, t₁ = 0. 3μ m, t₃ = 800 Å とした 時に、領域IIの最適コア厚t2の設計に関する計算結果 を示したものである。図7より、 $t_2 = 1.2 \sim 1.3$ μm程度に設定すると、領域 I ~光ファイバ間の結合損 失の総和が最小になり、その全結合損失は約3.5dB になる。なお、本発明による光結合デバイスを用いず に、領域 I の導波路端面から光ファイバに直接結合させ た時の結合損失は、約9dBである。従って、本発明に よる光結合デバイスにより、5.5 d B の損失改善が可 能になることになる。また、この時、光導波路207か らの出射光204と光ファイバとの軸ずれトレランス は、光ファイバ同士のトレランスと同程度になるので、 光ファイバを実装する時の光デバイスモジュール化が比 較的容易になる、という利点も得られる。

【0014】(実施例3)図8は、本発明による光結合 よく、通常、数10μmから数mmの長さにすれば、本 40 デバイスの第3の実施例の側断面図を表し、スポットサ イズ変換を領域IIの1段の光導波路で構成した場合を示 している。この場合、領域IIにおける光導波路のスポッ トサイズは、領域Iの光導波路スポットサイズと、結合 しようとする光ファイバのスポットサイズとの中間的な 大きさになり、領域I~II間および領域II~光ファイバ 間の結合損失の総和が最小値になるコアの屈折率nと寸 法w2 , t2 に設定される。従って、前記第2の実施例 より光導波路構造が単純であり、製作が容易になる特長 がある。例えば、波長 $\lambda = 1$. 55 μ mで、コア40 50 5, 406として1. 3 μ m組成の I n G a A s P を用 $v_1 = w_1 = w_2$) = 1. 5 μ m, t₁ = 0. 3 μ mとして $W_{\epsilon} = 4 \mu m$ の光ファイバに結合させる場合、 領域IIの光導波路のコアの厚さt2を0.12μm程度 にすると、領域 I ~光ファイバ間の全結合損失は 4. 2 d B程度になり、低損失な結合特性を実現できる。な お、この場合の光導波路406からの出射光404に対 する光ファイバの軸ずれトレランスも、前記第2の実施 例とほぼ同等の特性が得られ、光ファイバ固定のための モジュール化が容易になる。

【0015】以上の実施例では、光結合デバイスとして 10 示す側断面図である。 1段もしくは2段の光導波路で構成した例を説明した が、さらに多段の光導波路を用いて同様に構成すれば、 低損失なスポットサイズ変換が可能である。また、光導 波路のコアの屈折率nが均一の材料を用いた場合を説明 したが、例えば、多重量子井戸層を用い、井戸層、障壁 層の材質および厚さを選択することにより、任意にその 実効的屈折率を設定できる。

【0016】また、以上の実施例では、光出射端側のコ アの寸法w, tを領域 I の導波路の寸法wi, ti より 小さくして、光波のスポットサイズを拡大する場合につ 20 いて説明したが、例えば、wをより広くし、tを極端に 薄くしたコアを構成してスポットサイズを変換しても良 W

【0017】また、本発明は、半導体デバイス以外に、 例えばLiNbO₃等の強誘電体材料やSiO₂等のガ ラス材料、あるいは有機材料等を利用した光デバイスに 適用できることは自明である。

【0018】本光結合デバイスは、半導体材料で構成で きるので、例えば、半導体レーザや光変調器、レーザダ イオードアンプ、光スイッチ等の光機能素子の光入出射 30 フである。 端部に、本結合デバイスを同一基板上にモノリシック集 積化した光デバイスを実現することも可能である。この 場合、半導体基板上に、光機能素子導波路を形成する時 に、本光結合用導波路を同時に形成する、あるいは光機 能素子部を形成した後、互いの導波路を直接突合せるよ うに光結合用導波路を形成しても良い。

【0019】さらに、以上の実施例では、光ファイバを 接続する場合について説明したが、この他に、他の半導 体光導波路部品、あるいはガラス導波路部品などのあら ゆる光導波路部品との接続部に対しても、それら導波路 40 208,408 ストップ層 の光スポットサイズに合わせるように、本発明による光 結合デバイス導波路の材質、寸法を設定すれば、低結合 損失の特性を実現できる。

[0020]

【発明の効果】以上説明したように、本発明では、スポ ットサイズ変換部の光導波路コア部の寸法をステップ状 にして構成することにより、低損失な特性を得るととも に製作性を改良した光結合デバイスを実現可能としてい

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による光結合デバイスの第1の実施例を 示す斜視図である。

【図2】本発明による光結合デバイスの第1の実施例を

【図3】本発明による光結合デバイスの第1の実施例を 示す上面図である。

【図4】本発明による光結合デバイスの第2の実施例を 示す側断面図である。

【図5】本発明による光結合デバイスの第2の実施例を 示す上面図である。

【図6】本発明の第2の実施例における動作原理および 効果を説明するための図であり、コア幅と光ファイバ結 合損失との関係を示すグラフである。

【図7】本発明の第2の実施例における動作原理および 効果を説明するための図であり、コア厚と光ファイバ結 合損失との関係を示すグラフである。

【図8】本発明による光結合デバイスの第3の実施例を 示す側断面図である。

【図9】従来の光結合デバイスの概略構成図である。

【図10】従来の他の光結合デバイスの上面図である。

【図11】従来の他の光結合デバイスの側断面図であ る。

【図12】従来の他の光結合デバイスの特性を示すグラ

【符号の説明】

101,501,601 光導波路コア

102, 202, 402, 502, 602 クラッド領 域を構成するn形半導体基板

103, 203, 403, 503, 603 クラッド領 域を構成するiもしくはp形半導体層

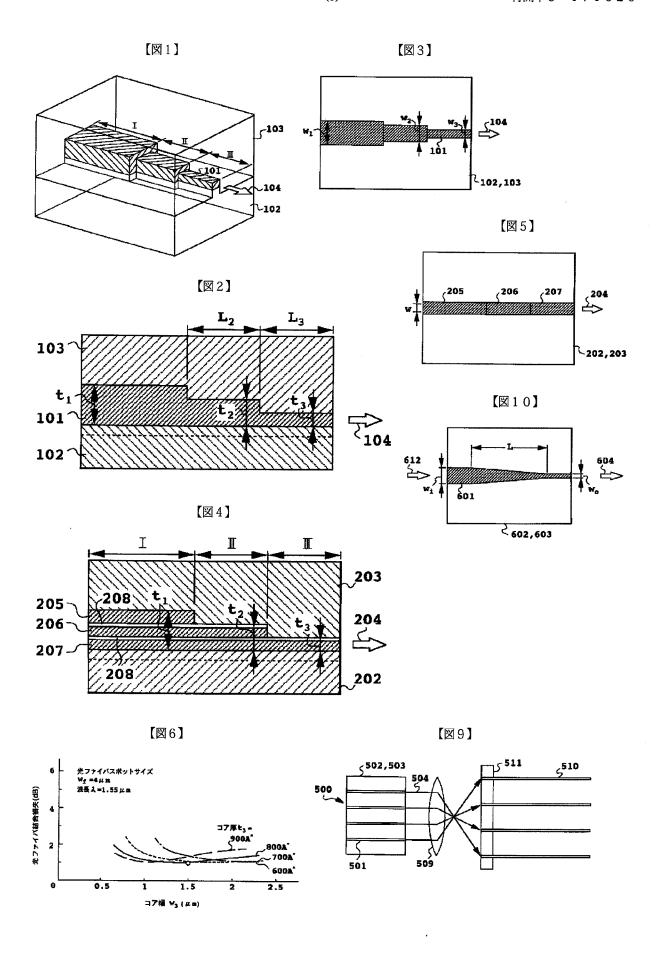
104, 204, 404, 504, 604 出射光 205, 206, 207, 405, 406 光導波路コ ア

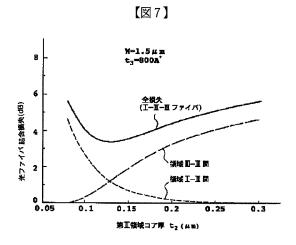
509 レンズ

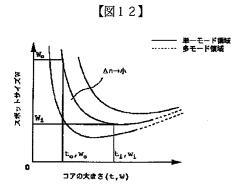
510 光ファイバ

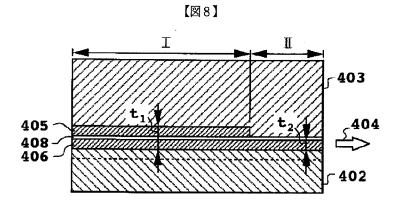
511 Vーグルーブアレー

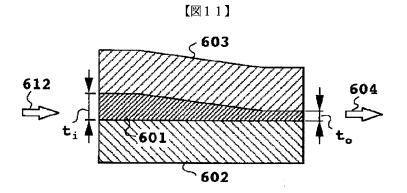
612 入射光











フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6 H O 1 L 31/0232

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所